

材料化学システム工学討論会 2015

参加者募集

主催 化学工学会 材料・界面部会

本討論会は、化学システム工学の視点に基づいて、材料の示す物性・現象からその開発まで幅広く徹底的に議論することを主旨としています。第7回目となる今回は、気鋭の部会若手研究者に加えて、研究者を志す博士後期課程学生にも話題提供して頂き、十分な時間をかけ発表と討論を同時に進めていきます。また、新たな試みとして、一般講演者には研究に対する自身のビジョンも語って頂きます。本討論会は、話題提供者との十分な時間をかけた活発な討論・交流により、参加者の相互啓発を行うとともに、将来につながる研究者間のネットワーク構築を目指しております。講演の一般公募は行いませんが、分野を超えた多くの若手研究者、研究者を志す学生の積極的参加をお待ちしております。

日時 2015年8月31日(月), 9月1日(火)

場所 東京工業大学 大岡山キャンパス 本館1階 H112室(東京都目黒区大岡山 2-12-1)

プログラム(案)

8月31日(月)

13:30~15:20 「高分子中の相分離(発泡)と光架橋重合に関する化学プロセス工学

—高分子化学工学の体系化を目指して—

(金沢大学)(正)瀧 健太郎氏

15:30~17:20 「分子拡散性のマイクロモデリングとバイオインスパイアード材料システム開発」

(東京工業大学)(正)大橋 秀伯氏

17:30~18:10 「細孔表面ラフネスを考慮した規則シリカ多孔体モデルによる吸着ヒステリシス機構の解明」

(京都大学)(学)平塚 龍将氏

18:30~ 懇親会

9月1日(火)

9:00~10:50 「ナノ空間設計による吸着特性制御とその工学的モデル化」

(京都大学)(正)田中 秀樹氏

11:00~12:20 「自己組織化膜を基盤とする分子認識プロセスの設計」

(大阪大学)(正)菅 恵嗣氏

12:30~13:30 「pH 勾配下でのベシクルのアメーバ的構造変化とそのメカニズム」

(同志社大学)(学)名和 愛利香氏

参加費 無料

懇親会費 実費(3~4千円程度を予定)

参加申込締切 2015年7月31日(金)

申込方法 参加者のお名前、所属、連絡先(e-mail、携帯電話番号等)をご記入の上、E-mailにて下記連絡先までお申し込み下さい。

申込先 〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 R1-17

東京工業大学 資源化学研究所 大柴 雄平

e-mail: oshiba.y.aa@m.titech.ac.jp